———— ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОХИМИЯ **—**

УДК:621.382+620.18+544.18+544

МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ЛИТИЯ В 4H—SiC, ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНОВ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ Si—C—Li

© 2024 г. С. М. Асадов^{a, δ}, *, С. Н. Мустафаева b , В. Ф. Лукичев c

^аМинистерство науки и образования Азербайджана, Институт катализа и неорганической химии им. М.Ф. Нагиева, АZ-1143 Баку, Азербайджан

⁶Министерство науки и образования Азербайджана, Научно-исследовательский институт "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия (НИИ ГПНГХ АГУНП)", AZ-1010 Баку, Азербайджан

^вМинистерство науки и образования Азербайджана, Институт физики, AZ-1143 Баку, Азербайджан

^гРоссийская академия наук, Физико-технологический институт им. К.А. Валиева, 117218 Москва, Россия

*e-mail: salim7777@gmail.com; mirasadov@gmail.com

Поступила в редакцию 29.06.2023 г. После доработки 31.05.2024 г. Принята к публикации 02.06.2024 г.

Используя теорию функционала плотности (DFT) исследованы адсорбционные, электронные и термодинамические свойства $2\times2\times1$ и $3\times3\times1$ суперъячеек бинарных соединений $A_nB_m=4H-SiC$, $\alpha-Li_2C_2$, Li_nSi_m) системы Si-C-Li. Установлено, что теоретическая емкость гексагонального политипа 4H-SiC, больше, чем у графита (370~MA·ч/r), используемого в качестве анодного материала для литий-ионных аккумуляторов. Кристаллические соединения A_nB_m обладают электронной проводимостью. При DFT-расчетах использовали обменно-корреляционный функционал в рамках обобщенного градиентного приближения (GGA PBE). Рассчитаны параметры кристаллической структуры, энергия адсорбции адатома Li_{ads} на подложке 4H-SiC, электронная зонная структура и термодинамические свойства суперъячеек соединений A_nB_m . Определены термодинамически выгодное расположение Li_{ads} и стабильная конфигурация суперъячеек $4H-SiC < Li_{ads} >$. Проведены DFT-расчеты энтальпии образования соединений A_nB_m в тройной системе Si-C-Li. Вычисленные характеристики соединений A_nB_m согласуются с экспериментальными данными. Используя стандартные термодинамические потенциалы соединений A_nB_m и изменение энергии в твердофазных реакциях обмена между этими соединениями установлены равновесные конноды в концентрационном треугольнике Si-C-Li. Построено изотермическое сечение фазовой диаграммы Si-C-Li при 298~K.

Ключевые слова: DFT-, GGA-, PBE-расчет, суперъячейки бинарных соединений, Si-C-Li, энергия адсорбции лития, электронная структура и термодинамические свойства

DOI: 10.31857/S0044453724110039, EDN: FAMTGQ

ВВЕДЕНИЕ

Материалы на основе бинарных соединений $(A_nB_m = 4H-SiC, \alpha - Li_2C_2, Li_nSi_m, где n и m - стехиометрические коэффициенты) тройной системы Si-C-Li представляют практический интерес, в частности, для перезаряжаемых Li-ионных батарей (LIB). Политипы полупроводникового SiC [1], а также полуметаллические соединения <math>Li_2C_2$ [2] и Li_nSi_m [3] являются ионными проводниками и ионообменниками. Соединения A_nB_m используются в качестве материалов электрода (анода) для LIB [4]. Однако, характеристики LIB сильно зависят от структуры, состава и свойств материалов

электрода. Фазовые равновесия, термодинамические свойства и структура бинарных и некоторых тройных сплавов системы Si–C–Li изучены [5–8] недостаточно. Анализ известных работ по системе Si–C–Li показывает следующее.

Система Si—C. SiC является единственным соединением в системе Si—C. SiC имеет несколько политипов: кубический (3C—SiC цинковая обманка), гексагональные политипы (2H—SiC вюрцит, 4H—SiC, 6H—SiC) и ромбоэдрический (15R) [9—11]. Политипия, которая является частным случаем полиморфизма, усложняет синтез соединения SiC с заданной структурой и свойствами. В частности, нанодисперсные слои 4H—SiC имеют электронный

тип проводимости и обладают заметными адсорбционными свойствами [1].

Система Li-C. В этой системе образуются несколько бинарных соединений Li_nCi_m (Li_4C , Li_6C_2 , Li_2C_2 , Li_8C_3 , Li_6C_3 , Li_4C_3 , LiC_6 , LiC_{12} и LiC_{18}) [12]. За исключением Li_2C_2 указанные составы Li_nC_m термодинамически метастабильны. Рассчитанная по рентгеновским данным длина связи C-C в Li_2C_2 , равная 1.226 Å, согласуется с межатомным расстоянием для тройной связи C=C. Фаза Li_2C_2 имеет фазовый переход (α ← β) при $T \approx 725$ K [13].

Параметры решетки низкотемпературной орторомбической модификации α — Li_2C_2 (пространственная группа Immm, № 71), Z = 2, 298 K) следующие [12]: a = 363.0(1) пм, b = 483.8(1) пм, c = 540.6(2) пм, V = 0.09494(9) нм³. Параметр элементарной ячейки кубической гранецентрированной модификации β — Li_2C_2 составляет a = 596.5 пм.

Структурные изменения $\alpha-\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$ при высоком давлении исследованы методом рамановской спектроскопии до давлений 30 ГПа при комнатной температуре [14]. Около 15 ГПа $\alpha-\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$ претерпевает переход в ацетилидную фазу высокого давления, около 25 ГПа эта фаза аморфизируется. В $\alpha-\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$ ионы Li координируются четырьмя связями С—С, а каждое гантелеобразное звено из С—С — восемью ионами Li.

Соединение $\alpha-\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$ имеет высокую теоретическую удельную емкость (1400 мА·ч/г) среди литийсодержащих материалов для LIB. В работе [15] указано, что половина лития может быть извлечена из $\alpha-\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$, и обратимая удельная емкость составит 700 мА·ч/г. Методом DFT изучена кристаллическая ячейка, полная и локальная плотность состояний, а также зонная структура $\alpha-\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$. Указано, что электронная и ионная проводимость отвечают за потенциальный зазор между зарядом и разрядом в LIB.

Низкая электропроводность $\alpha-\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$ затрудняет его применение в LIB. Условие синтеза нанолистов на основе $\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$, состоящих из $\mathrm{sp^2}$ -гибридизированных атомов углерода, описано в работе [16]. Нанолисты $\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$ формируются непосредственно из элемента Li и углерода в процессе измельчения в шаровой мельнице. Указано, что вертикально ориентированная нанолистовая фольга $\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$, полученная прессованием измельченного порошка, может использоваться в качестве материала электродов в LIB. После удаления лития из фольги $\mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$ получаются нанолисты аморфного углерода. Электрохимические характеристики указывают на высокую обратимость поглощенного Li в аморфных углеродных нанолистах.

Система Li-Si. Материалы системы Li-Si для анода LIB считаются одними из альтернативных графиту [17, 18]. Это связано с их высокой теоретической емкостью (например, для

 ${\rm Li}_{15}{\rm Si}_4 - 3579~{\rm MA\cdot q/r})$ при комнатной температуре [19], концентрацией Si в земной коре и низким плато среднего напряжения ($\approx 0.4~{\rm B}$ против Li/Li⁺) в LIB [20].

Фазовая диаграмма и термодинамические свойства твердых сплавов и бинарных соединений $\text{Li}_n \text{Si}_m$ системы $\text{Li}_- \text{Si}$ изучены во многих работах [20, 21]. Рассмотрено также применение $\text{Li}_n \text{Si}_m$ в среднетемпературных силовых элементах различного назначения в LIB [17, 22]. В системе $\text{Li}_- \text{Si}$ образуются несколько соединений (LiSi , $\text{Li}_1 \text{Si}_7, \text{Li}_7 \text{Si}_3, \text{Li}_1 \text{Si}_4, \text{Li}_1 \text{Si}_4, \text{Li}_2 \text{Si}_5)$. Методом DFT изучена зонная структура, электронные и механические свойства кристаллических и аморфных сплавов $\text{Li}_- \text{Si}$ [23–25].

Кремниевый анод, как и графит обладает высокой удельной емкостью хранения Li в В LIB. Однако, поглощение Li кремниевым анодом в LIB может приводить к образованию интерметаллических соединений Li_nSi_m [5]. Соединения Li_nSi_m резко увеличивают удельную емкость хранения Li в LIB. В этом случае объемное расширение анода Li_nSi_m увеличивается, что вызывает быструю деградацию анода и LIB при циклировании [6]. Термодинамические свойства Li_nSi_m также исследованы. Известны данные, в частности, по энтальпии образования и теплоемкости сплавов и соединений Li₁₂Si₇, Li₇Si₃, Li₁₃Si₄ [26], Li₁₂Si₇, Li₇Si₃, Li₁₃Si₄, Li₁₅Si₄, Li₂₂Si₅ [27], Li₂₂Si₅ [26, 28], Li₁₇Si₄, Li_{16.42}Si₄ [29], LiSi [30], Li_{1-x}Si_x: Li₁₂Si₇, Li₇Si₃ [31], Li₁₇Si₄, Li_{16.42}Si₄, Li_{16.42}Si₄ [32].

Система Si-C-Li. Фазовая диаграмма и термодинамические свойства сплавов тройной системы Si-C-Li изучены в работе [6]. Приведены результаты экспериментов по отжигу сплавов Si-C-Li и дифференциальной сканирующей калориметрии. Установлены области трехфазных равновесий при 903–923 К. Проведено термодинамическое описание тройной системы Si-C-Li с учетом данных по двойным граничным системам Si-Li, C-Li и Si-C. Показано, что растворимость Li в соединениях систем Li-C, Li-Si, а также в SiC в твердом состоянии незначительна [5–7].

С учетом парциальных давлений компонентов системы Si-C-Li анализированы данные по температурной зависимости свободной энергии образования Гиббса фаз SiC и $\alpha-Li_2C_2$ ($\beta-Li_2C_2$). Для изученных сплавов системы Si-C-Li использована модель ассоциированных растворов. Термодинамическим методом рассчитаны отдельные участки фазовой диаграммы Si-C-Li [5, 6].

Из анализа вышеуказанных работ следует, что вопросы, связанные с адсорбцией лития в политипе 4H–SiC, электронной структурой, энтальпией образования ($\Delta_p H^0$) соединений $A_n B_m$ и фазовыми равновесиями в системе Si–C–Li до конца не решены. При синтезе и подборе материалов

электродов для LIB необходимы также данные по термодинамическим величинам, в частности, $\Delta_f H^0$ соединений $A_n B_m$ и фазовым равновесиям в системе Si—C—Li.

Целью настоящей работы является моделирование и ab initio расчет плотности адсорбции атомов лития на поверхности 4H—SiC, электронного переноса и термодинамических функций фаз и структур на основе суперъячеек Si—C—Li.

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ

Структурные, адсорбционные, электронные и термодинамические свойства бинарных соединений ($A_n B_m = 4H - SiC$, $\alpha - Li_2 C_2$, $Li_n Si_m$) системы Si-C-Li нами определены на основе расчета полных энергий предварительно релаксированных параметров кристаллических решеток $2 \times 2 \times 1$ и 3×3×1 суперъячеек соединений. Расчеты зонной структуры $A_n B_m$ проводили методом теории функционала плотности (DFT) с использованием программы ATK [33, 34]. DFT-расчеты проводили разложением волновых функций в базисном наборе в виде плоских волн с использованием модели "суперъячейки". Количество плоских волн определяли обрезанием кинетической энергии с учетом валентных электронов атомов (Si – [Ne] $3s^23p^2$, $C - [He]2s^22p^2$, Li – [He]2s¹) в основном состоянии компонентов Si-C-Li. Кинетическая энергия отсечки была установлена равной 500 эВ. Обменно-корреляционные эффекты рассчитаны в рамках обобщенного градиентного приближения (GGA PBE) [35, 36].

Допуски сходимости при DFT-GGA-PBE-оптимизации постоянных кристаллических решеток соединений системы Si-C-Li составляли 10^{-5} эB/атом для изменения энергии и 0.03 эB/Å для изменения электрической силы, действующей на ядра молекул в веществе, соответственно. DFT- расчетами суперъячеек соединений $A_n B_m$ оптимизировали параметры кристаллических решеток. Элементарные ячейки соединений $A_n B_m$ рассчитывали в обратном пространстве. С учетом этого в первой зоне Бриллюэна были выбраны k-точки с высокой симметрией.

Сходимость релаксированной энергии по отношению к выборке k-точки составляла, в частности, \sim 5 мэВ на формульную единицу SiC. В зоне Бриллюэна в обратном пространстве интегрирование проводили схемой Монхорста—Пака с сеткой из $5 \times 5 \times 5$ k-точек.

DFT-GGA-PBE-расчеты энергии адсорбции Li_{ads} на подложке 4H—SiC, электронной структуры и энергии образования соединений $A_n B_m$ сравнивали с известными данными.

Энергия адсорбции Li_{ads} . Энергию адсорбции лития ($E_{\mathrm{Li}_{ads}}$) на поверхности гексагонального

политипа 4H—SiC рассчитывали по методике DFT GGA PBE, описанной в [37]. Расчет $E_{\rm Li_{ads}}$ проводили для трех разных центров адсорбции (сайт) адатома ${\rm Li_{ads}}$ на подложке 4H—SiC. Места расположения адатома ${\rm Li_{ads}}$ на подложке 4H—SiC соответствовали В-, H- и T-сайтам.

Здесь В-сайт — мостиковое расположение адатома на подложке 4H—SiC, H-сайт — углубление в центре структуры 4H—SiC и T-сайт — расположение адатома Li_{ads} сверху атомов Si и/или C подложки. Другими словами, в В-сайте адатом Li_{ads} расположен в мостиковом участке между Si—C связи, H-сайте Li_{ads} расположен в центре шестичленного кольца Si—C связи и T-сайте адатом расположен сверху атомов Si и/или C в структуре карбида кремния, включающего адатом лития 4H—SiC<L i_{ads} >. Энергию адсорбции $E_{Li_{ads}}$ адатома Li_{ads} на подложке 4H—SiC вычисляли по формуле

$$E_{\text{Li}_{\text{ads}}} = \frac{1}{n_{\text{Li}}} (E_{\text{SiC}\langle \text{Li}_{\text{ads}} \rangle} - E_{\text{SiC}} - n_{\text{Li}} E_{\text{Li}}), \quad (1)$$

где $E_{\rm SiC < Li_{ads} >}$ и $E_{\rm SiC}$, — полные энергии системы 4H—SiC < Li_{ads} > с Li-адсорбатом и чистой поверхности 4H—SiC, соответственно, $n_{\rm Li}$ — количество адатома лития, $E_{\rm Li}$ — энергия изолированных атомов лития. Сначала DFT GGA PBE вычисляли энергии $E_{\rm SiC}$, $E_{\rm Li}$ и $E_{\rm SiC < Li_{ads} >}$, а затем из (1) рассчитывали энергию адсорбции $E_{\rm Li_{ads}}$.

Расположение Li_{ads} на подложке 4H—SiC и равновесное расстояние (d_{eq}) между Li_{ads} и атомами подложки, т.е. длина адсорбционной связи, заметно влияют на величину $E_{\text{Li}_{\text{ads}}}$. В различных адсорбционных центрах (сайтах) подложки 4H—SiC до и после релаксации системы 4H—SiC<Li $_{\text{ads}}>$ вычисленные значения $E_{\text{Li}_{\text{ads}}}$ отличаются друг от друга.

Энергия образования A_nB_m . Энергию образования устойчивой конфигурации соединений ($A_nB_m = 4H-SiC$, $\alpha-Li_2C_2$, Li_nSi_m) в Si-C-Li методом DFT GGA PBE рассчитали при нулевой температуре по уравнению:

$$E_f = \left(\frac{1}{m+n}\right) \left[E_{A_m B_n}^{\text{total}} - \left(m E_A + n E_B \right) \right], \quad (2)$$

где $E_{{\rm A}_m{\rm B}_n}^{\rm total}$ — полная энергия соединения на формульную единицу ${\rm A}_n{\rm B}_m$; m,n — количество атомов Si, C и/или Li в элементарной ячейке соответственно; $E_{\rm A}$ и $E_{\rm B}$ — энергии элементов A и B соответственно (в расчете на один атом).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Атомная структура. В наноразмерных поверхностях адатомы и размерные эффекты могут вносить вклад в общий энергетический баланс подложки. В DFT-расчетах малый вклад (по сравнению с кинетическими и кулоновскими членами)

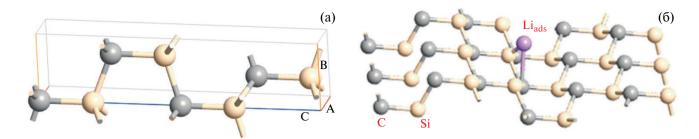


Рис. 1. Атомная структура $2\times2\times1$ суперъячеек 4H–SiC (a) и 4H–SiC<Li_{ads}> (б).

квантово-механического обмена и корреляции энергии в функционал полной электронной плотности частиц учитывали с использованием стандартного функционала GGA PBE.

На рис. 1 приведены оптимизированные атомные структуры $2\times2\times1$ суперъячеек гексагонального политипа 4H—SiC и 4H—SiC<Li_{ads}>.

DFT-GGA-PBE-рассчитанные оптимизированные параметры решеток бинарных соединений граничных систем в Si—C—Li приведены в табл. 1.

Сравнение DFT-GGA-расчетных (табл. 1) и экспериментальных данных для 4H–SiC (a=3.0798, b=3.0798, c=10.0820 Å [1]; a=3.08051(6), b=3.08051(6), c=10.08480(4) Å [38], $\alpha-\text{Li}_2\text{C}_2$ a=3.6520(1), b=4.8312(2), c=5.4344(1) Å [12]; a=3.669, b=4.8851, c=5.468 Å [39]; и LiSi a=9.353, b=9.353, c=5.753 Å [23]) показывает, что параметры кристаллических решеток этих фаз хорошо согласуются между собой.

В суперъячейке 4H—SiC<Li $_{ads}$ > длина адсорбционной связи d_{ads} зависит от вида атомов подложки и положения Li $_{ads}$ на подложке. В суперъячейке 4H—SiC<Li $_{ads}$ >, где Li $_{ads}$ находится в трех положениях (H-, T- и B-сайты), длина связи d имеет три различных значения. Например, в мостиковом положении (B-сайт) адатома Li $_{ads}$ Длина связи d имеет следующие значения: Si—C (1.9 Å), Li—C (2.19 Å), Li—Si (1.37 Å) соответственно.

Энергия адсорбции Li_{ads} . DFT-GGA-PBE-расчеты энергии адсорбции ($E_{\rm Li_{ads}}$) в случае адсорбции одного атома лития Li_{ads} на подложке 4H—SiC показывают, что адсорбция Li_{ads} является экзотермической реакцией. Это означает, что на поверхности 4H—SiC литирование термодинамически возможно. Результаты расчетов $E_{\rm Li_{ads}}$ в системе 4H—SiC<Li_{ads}> приведены в табл. 2.

Значение $E_{\rm Li_{ads}}$ кроме положения адатома ${\rm Li_{ads}}$ на SiC-подложке, зависит также от межатомных расстояний. Различное расположение адатома ${\rm Li_{ads}}$ на сайтах подложки 4H—SiC приводит к отличиям в значениях $E_{\rm Li_{ads}}$. Наиболее стабильным положением адатома ${\rm Li_{ads}}$ в системе 4H—SiC< ${\rm Li_{ads}}$ > является H-сайт, т.е. когда адатом ${\rm Li_{ads}}$ расположен в полом положении на подложке 4H—SiC. Как видно

Таблица 1. DFT-GGA-PBE-оптимизированные параметры элементарной ячейки соединений суперъячеек 4H—SiC (гексагональная сингония), $\pm - \text{Li}_2\text{C}_2$ (орторомбическая сингония) и LiS (Z=16, тетрагональная сингония)

Соедине-	Пространствен- ная группа (пр. гр.)	Параметры элемен- тарной ячейки, Å		
		а	b	c
$\begin{array}{c} \text{4H-SiC} \\ \alpha - \text{Li}_2\text{C}_2 \\ \text{LiSi} \end{array}$	$P6_3, mc, (No 186)$ Immm, (No 71) $I4_1/a, (No 88)$	3.092 3.647 9.352	3.092 4.845 9.352	10.117 5.411 5.752

Таблица 2. DFT-GGA-PBE-рассчитанные значения длин адсорбционных связей $d_{\mathrm{SiC-Li}_{\mathrm{ads}}}$ (Å) и энергии адсорбции $E_{\mathrm{Li}_{\mathrm{ads}}}$ (эВ) в различных положениях $\mathrm{Li}_{\mathrm{ads}}$ на подложке 4H—SiC (n-тип)

Положение Li _{ads} на подложке	DFT-GGA-PBE- расчет		Расчет [40]
4H–SiC	d, Å	$-E_{\mathrm{Li}_{\mathrm{ads}}}$, $\ni \mathbf{B}$	$-E_{\mathrm{Li}_{\mathrm{ads}}}$, $\ni \mathrm{B}$
T (top C) T (top Si) B H	1.67 1.69 2.17 2.19	0.27 0.11 0.12 0.37	0.45 0.41

из табл. 2, дефектность структуры повышает адсорбционные свойства подложки, и энергия адсорбции Li_{ads} Стоуна—Уэльса (SW) дефектного карбида кремния SW—SiC уменьшается по сравнению с бездефектным 4H—SiC.

Плотности электронных состояний (DOS). В наших DFT-GGA-PBE-расчетах электронной структуры соединений A_nB_m системы Si-C-Li энергия разделения основных и валентных состояний потенциала GGA составляла −7.11 эВ. Вычисленные значения постоянной решетки A_nB_m совпадали с экспериментальными значениями. Рассмотрим DOS 4H-SiC<Li_{ads}> (гексагональная сингония, пр. гр. $P6_3$, mc, № 186, Z=6).

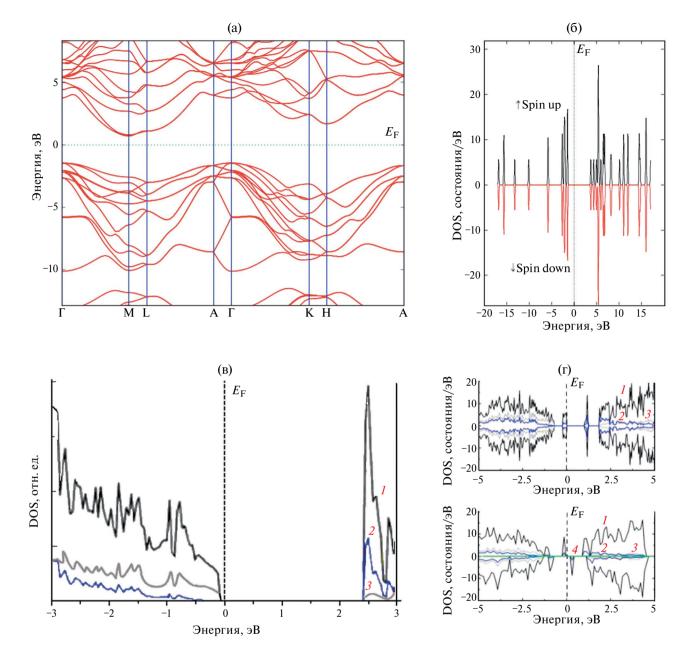


Рис. 2. DFT-GGA-PBE-рассчитанные электронная зонная структура (а), полная DOS (б) и парциальная плотности состояний PDOS (в) $3 \times 3 \times 1$ суперъячеек на основе 4H—SiC и SW—SiC—Li_{ads} (г). PDOS, показывают отдельные вклады каждой атомной орбитали без учета эффекта спин-орбитальной связи. 1 — полная DOS, 2 — PDOS для Si, 3 — PDOS для C, 4 — PDOS для Li. Уровень Ферми установлен на ноль эВ.

DFT-GGA-PBE-расчетные изменения зонной структуры и плотности электронных состояний (DOS) суперъячеек 4H—SiC и 4H—SiC<Li $_{ads}>$ качественно аналогичны. Это связано с тем, что зоны Бриллюэна для этих структур имеют идентичные размеры элементарной ячейки.

Рассчитанные DFT-GGA-PBE без учета эффекта спин-орбитальной связи, зонная структура и DOS суперъячеек на основе 4H–SiC показывают следующее. Из зонной структуры 4H–SiC<Li_{ads}>

следует, что он, как и 4H—SiC, является полупроводником n-типа с непрямой шириной запрещенной зоны $E_{\rm g}=2.16$ эВ (рис. 2а). Здесь же (рис. 26—г) приведены рассчитанные общая (б) и парциальная плотности состояний PDOS (в) $3\times3\times1$ суперъячеек на основе 4H—SiC и для сравнения PDOS системы SW—SiC—Li_{ads} (г), содержащей дефект Стоуна—Уэльса (SW) [8].

Вышеуказанное значение $E_{\rm g} = 2.16$ эВ 4Н— SiC без учета эффекта спин-орбитальной связи,

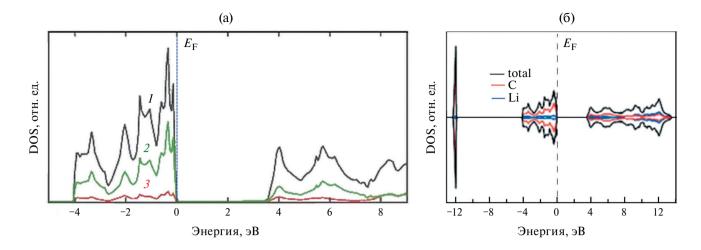


Рис. 3. Полная (DOS) и парциальная электронная плотность состояний (PDOS) $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$ с орторомбической сингонией: a) -1 - DOS, 2 - PDOS C2s-2p-состояние, 3 - PDOS Li 1s-состояние; б) - DOS $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$. Уровень Ферми установлен на ноль эВ.

рассчитанное нами, отличается от экспериментальной величины $E_{\rm g}=3.26$ эВ для чистого 4H—SiC [1] и близко к стандартному DFT расчетному значению $E_{\rm g}=2.2$ эВ для 4H—SiC [41,42].

Сужение запрещенной зоны n-типа 4H— $SiC < Li_{ads} >$ в расчетах, кроме ограничения метода DFT-GGA, может быть связано также с малым вкладом адатома Li_{ads} в электронную структуру. Экспериментальные данные для легированных полупроводников, в частности, 4H—SiC также показывают сужение $E_{\rm g}$. В модифицированных вариантах ab initio расчетов используют различные квазичастичные коррекции собственной энергии электрона, которые позволяют получить значения $E_{\rm g}$, согласующиеся с экспериментальными [33, 34].

DFT-GGA-расчеты показывают отсутствие магнитного момента в 4H—SiC<Li_{ads}>. Для электронов со спином вверх и со спином вниз PDOS оказываются одинаковыми (рис. 2б). Это указывает на отсутствие магнитной поляризации атомов лития в данной структуре.

Абсорбция Li_{ads} на подложке 4H—SiC сдвигает пики DOS относительно уровня Ферми E_F чуть вправо (рис. 3а). По сравнению с 4H—SiC такой сдвиг пиков DOS суперъячейки 4H—SiC<Li $_{ads}$ > означает, что адатом Li_{ads} передает часть электронов в 4H—SiC, и за счет этого энергетические состояния атомов слабо смещаются.

Когда адатом Li_{ads} адсорбируется на поверхности 4H—SiC интенсивность пиков DOS s-состояния электронов атомов становится слабой. В спектре DOS наблюдаются только сдвиги и уширения пиков p-состояния. За счет очень низкой концентрации лития (<1 ат.%) полная плотность электронных состояний суперъячейки 4H—SiC< Li_{ads} >сохраняет форму DOS чистого 4H—SiC (рис. 3a).

В этом случае вблизи энергии Ферми основной вклад в DOS вносят 2p-состояния углерода (C-2p) и узкое 2p-состояние кремния (Si -2p). Таким образом, за счет передачи электронов s-состояния адатома Li_{ads} в 4H-SiC пики DOS p-состояния смещаются.

Локальная плотность состояний атомов в низкотемпературной модификации $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$ состоит из парциальных вкладов PDOS орбиталей как лития, так и углерода (рис. 3а, б). PDOS Li 1s-состояния незначительная, проявляется вблизи уровня Ферми (4-8 эВ) и при низких энергиях (от 0 до –4 эВ). Вклад гибридизации атомных орбиталей $C2s-2p~(sp^1)$ в спектре PDOS $\alpha-Li_2C_2$ в указанном интервале энергий характеризуется более сильными пиками. PDOS-орбитали углерода C2s соответствуют в основном отрицательным энергиям. А парциальные электронные состояния углерода вблизи уровня Ферми соответствуют С2р-состояниям. В спектре DOS $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$ спин вверх и спин вниз плотности состояний симметричны, и поэтому в $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$ локальный магнетизм не обнаружен. Указанное выше соответствует DFT-данным DOS $\alpha - \text{Li}_{2}\text{C}_{2}$ [15].

Согласно фазовой диаграмме Li—Si среди вышеуказанных соединений Li_nSi_m три состава (Li₂₂Si₅, Li₁₂Si₇ и LiSi) образуются по перитектической реакции [21]. В частности, LiSi плавится инконгруэнтно при 743 К. Рассчитанные параметры кристаллической структуры LiSi (табл. 1), межатомные расстояния (Li—Li, 2.67 Å; Si—Si 2.47 Å; Li—Si 2.63 Å) и валентные углы согласуются с экспериментальными данными (DOS LiSi (тетрагональная сингония, пр. гр. $I4_1/a$, № 88, Z = 16)). В LiSi 16 атомов Li и 16 атомов Si упорядочены в элементарной ячейке. Так как LiSi имеет узкую запрещенную

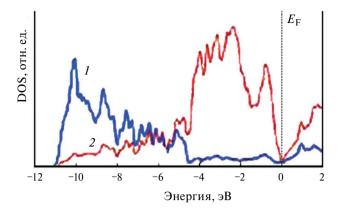


Рис. 4. Электронная плотность состояний DOS соединения LiSi. 1 - Si 3s-состояние, 2 - Si 3p-состояние. Уровень Ферми установлен на ноль эВ.

зону 0.057 эВ в полном DOS запрещенная зона LiSi не обнаруживается. Сильная s-p-гибридизация, приводящая к тетраэдрической структуре sp^3 , в фазе LiSi дает меньшую ширину запрещенной зоны, чем в кристаллической фазе чистого Si. В спектре DOS LiSi энергии $1s^22s^1$ состояний для Li незначительные. Однако, присутствие Li в фазе LiSi снижает степень s-p-гибридизации.

Плотность состояний электронов LiSi в области энергий от -12 до 2 эВ показана на рис. 4. Расщепление между 3s- и 3p-состояниями Si увеличивается при переходе от LiSi к более высоким литированным состояниям Li_{1-x}Si [23].

Энергия образования A_nB_m . Рассмотрим энтальпию образования бинарного соединения A_nB_m . Изменение стандартной энтальпии образования одного моля данного химического соединения из входящих в него компонентов при температуре T в термодинамике записывается как

$$\Delta_f H_T^0 = \Delta_f H_0^0 + \int_0^T \Delta C_p dT, \tag{3}$$

где $\Delta_{\it f} H_0^{\,\circ}$ — энтальпия образования химического соединения при $0~{\rm K},\,\Delta C_p$ — мольная теплоемкость вещества при постоянном давлении. Принимается, что в соединении ${\rm A}_n {\rm B}_m$ отсутствует фазовое превращение.

Тогда величину $\Delta_f H_0^\circ$ соединения $\mathbf{A}_n \mathbf{B}_m$ можем вычислить уравнением

$$\Delta_{f}H_{T}^{o}(\mathbf{A}_{n}\mathbf{B}_{m}) = H_{T}^{o}(\mathbf{A}_{n}\mathbf{B}_{m}) - (1-x)H_{0}^{o}(\mathbf{A}) -$$

$$-(x)H_{0}^{o}(\mathbf{B}) + \int_{0}^{T} [C_{p}(\mathbf{A}_{n}\mathbf{B}_{m}) - (1-x)C_{p}(\mathbf{A}) -$$

$$-(x)C_{p}((x))]dT.$$

$$(4)$$

Здесь энтальпии образования простых веществ элементов A и B, т.е. величины $H_0^{\circ}(A)$ и $H_0^{\circ}(B)$

равны нулю. Величина C_p соединений A_nB_m системы Si—C—Li не сильно отличается от суммы справочных данных C_p атомарных элементов A и B при 298 K [4, 34, 35], что соответствует правилу Неймана—Коппа. Поэтому в расчетах энергии образования $A_{1-x}B_x$ при 298 K изменение $\Delta C_p = f(T)$ в интервале 0—298 K принимали равным нулю.

Учитывая вышеуказанные, можно принять, что, $\Delta_f H_T^\circ (A_n B_m) \approx \Delta_f H_0^\circ (A_n B_m)$ и эту величину можем заменить изменением внутренней энергии $\Delta_f U_0^\circ (A_n B_m)$

$$\Delta_f H_0^{\text{o}}(\mathbf{A}_n \mathbf{B}_m) = \Delta_f U_0^{\text{o}}(\mathbf{A}_n \mathbf{B}_m). \tag{5}$$

С другой стороны величина $\Delta_f U_0^{\circ}(A_n B_m)$ характеризует энергию образования устойчивой конфигурации соединения $A_n B_m$. С учетом этого для DFT расчетов энергии образования $E_f(A_n B_m)$ на один атом можем написать

$$\Delta_f U_0^{\text{o}} \left(\mathbf{A}_n \mathbf{B}_m \right) = E_f \left(\mathbf{A}_n \mathbf{B}_m \right) =$$

$$= \left(\frac{1}{m+n} \right) \left[E_{\mathbf{A}_n \mathbf{B}_m}^{\text{total}} - \left(n E_{\mathbf{A}} + m E_{\mathbf{B}} \right) \right]$$
(6)

DFT-GGA-вычисленные нами по формуле (6) энтальпии образования соединений $A_n B_m$ системы Si-C-Li приведены в табл. 3.

Анализ фазовых равновесий граничных подсистем Si—C, C—Li, Si—Li трехкомпонентной системы Si—C—Li и термодинамических свойств соединений A_nB_m показывает, что в Si—C—Li не образуются тройные промежуточные фазы. Конноды в субсолидусной области на концентрационном треугольнике системы Si—C—Li определили с учетом расчетных $\Delta_f H_{298}^\circ$ (табл. 3) и справочных [43] стандартных термодинамических потенциалов $\Delta_f G_{298}^\circ$ ($\Delta_f H_{298}^\circ$) бинарных соединений ($A_n B_m$). По методике, аналогично описанной в работе [46], оценили возможность протекания обратимых реакций замещения (7) или обмена (8) между компонентами системы Si—C—Li:

$$A_n C_m + q B \leftrightarrow A_n B_a + m C, \tag{7}$$

$$A_n B_m + C_r D_q \leftrightarrow A_n D_q + C_r B_m. \tag{8}$$

Согласно правилу фаз Гиббса в трехкомпонентных системах в термодинамическом равновесии могут находиться не более пяти фаз. В случае системы Si-C-Li этому отвечает возможность протекания твердофазных обменных реакций типа "2 = 2" (т.е. два исходных реагента и два продукта взаимодействия). Таким образом, с учетом вышеуказанных для фазовой диаграммы Si-C-Li построили изотермический разрез при 298 К (рис. 5) с использованием DFT-GGA-PBE-расчетов. Анализ изменения свободной энергии Гиббса для

твердофазных обменных реакций $\text{Li}_n \text{Si}_m - \text{Li}_2 \text{C}_2$ и $\text{Li}_n \text{Si}_m - \text{SiC}$ показывает, что последняя реакция протекает слева направо (значения ΔG , $\Delta H < 0$), и продукты взаимодействия сосуществуют между собою. То есть термодинамически стабильные комбинации фаз составляют исходные реагенты разрезов $\text{Li}_n \text{Si}_m - \text{SiC}$. Таким образом, в Si - C - Li установлены и другие стабильные конноды в твердом состоянии.

выводы

Методом DFT-GGA-PBE проведены ab initio исследования адсорбции лития Li_{ads} на подложке 4H-SiC, зонной и атомной структуры, а также термодинамических свойств 2×2×1 и 3×3×1 суперъячеек бинарных соединений ($A_n B_m = 4H - SiC$, $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$, Li_nSi_m) системы Si-C-Li. Оптимизированные параметры элементарной ячейки соединений суперъячеек 4H-SiC, $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$ и LiS хорошо согласуются с экспериментальными данными. Установлено, что наиболее стабильным положением адатома Li_{ads} на подложке 4H-SiC<Li_{ads}> является такое положение, когда адатом Li_{ads} находится θ полом положении (H-сайт). В этом случае энергия адсорбции $E_{\rm Li_{ads}}^{\rm H} = -0.37$ эВ по абсолютной величине наибольшая по сравнению с расположением Li_{ads} сверху атомов Si (и/или C) (Т-сайт; $E_{\text{Li}_{\text{ads}}}^{\text{T,C}} = -0.27$ эВ; $E_{\text{Li}_{\text{ads}}}^{\text{H,i}} = -0.11$ эВ) и мостиковой позиции (В-сайт; $E_{\text{Li}_{\text{ads}}}^{\text{H,i}} = -0.12$ эВ). Из указанных следует, что расположение Li_{ads} на подложке 4H—SiC в углублениях в центре шестичленного кольца Si-C связи (Н-сайт) более предпочтительно, чем в мостиковых участках между Si-C связями (B-сайт) и сверху (тетраэдрическая конфигурация; Т-сайт) атомов подложки 4H—SiC.

В суперъячейке 4H—SiC<Li $_{ads}$ > длина адсорбционной связи d_{ads} адатома Li $_{ads}$ зависит от положения Li $_{ads}$ и вида атомов (Si и/или С-грань) на подложке. В полом (Н-сайт), сверху атомов (Si и/или С-грань; Т-сайт) и мостиковом (В-сайт) положениях адатома длина адсорбционной связи имеет значение d_{ads} , Å): 2.19, 1.67—1.69 и 2.17 соответственно. Энергия адсорбции адатома структуры 4H—SiC<Li $_{ads}$ > по абсолютной величине меньше, чем у дефектного карбида кремния. Для структуры 4H—SiC<Li $_{ads}$ > значение E_{Li}^{H} составляет —0.37 эВ (Н-сайт) и —0.85 эВ для SW—SiC<Li $_{ads}$ >, соответственно.

Согласно DFT-GGA-PBE-расчетам зонной структуры 4H-SiC<Li $_{ads}>$ является полупроводником n-типа с непрямой шириной запрещенной зоны $(E_{\rm g})$. Без учета эффекта спин-орбитальной связи рассчитанная ширина запрещенной зоны $3\times3\times1$ суперъячейки 4H-SiC составляет $E_{\rm g}=2.16$ эВ. Это значение близко к DFT-LDA расчетному значению $E_{\rm g}=2.2$ эВ и меньше экспериментальной $E_{\rm g}=3.26$ эВ для 4H-SiC.

Таблица 3. DFT-GGA-вычисленные нами энтальпии образования соединений (на формульную единицу) системы Si-C-Li. Использованы стандартные состояния элементов — чистый Li (пр. гр. № 229 — Im3m, Si (пр. гр. № 227 — Fd3m) и C (графит, пр. гр. № 194 — $P6_3/mmc$) при 298.15 K

Соединение	$\Delta_{\!f}\!H^0$, кДж/моль	$\Delta_{f}H^{0}$ (298.15 K), кДж/моль
	DFT-GGA-PBE	Ссылки
$\alpha - SiC$	64.1	62.2 [43], 62.8 [6]
$\alpha - Li_2C_2$	61.1	68.4 [6]
Li ₁₇ Si ₄	462.1	460 [44]
$Li_{21}Si_5$	597.1	634.4 [26]
Li _{14,13} Si	133.4	
Li ₁₃ Si ₄	307.1	304 [28]
Li ₇ Si ₃	260.5	294 [28], 253 [31]
$Li_{12}Si_7$	237.2	256 [28], 235 [44]
LiSi	39.4	39 [44], 38 [45]

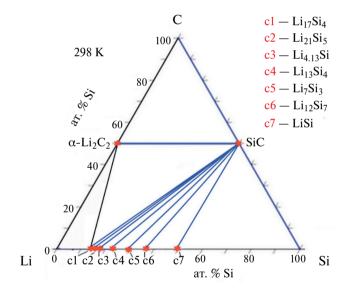


Рис. 5. Изотермический разрез системы Si–C–Li при 298 K, построенный на основе DFT-GGA-PBE-расчетов с учетом известных термодинамических и экспериментальных данных.

Согласно DFT-GGA-PBE-расчетам равновесное состояние структуры 4H— $SiC < Li_{ads} >$ определяется перераспределением заряда в основном между атомами Si и C из-за орбитальной гибридизации. В этом случае электронная плотность (DOS) переносится в выгодную адсорбционную область (H-сайт) в структуре 4H—SiC— Li_{ads} , где расстояния между атомами короткие. Абсорбция Li_{ads} сдвигает пики DOS суперъячейки 4H— $SiC < Li_{ads} >$ относительно уровня Ферми E_F чуть вправо. Такой сдвиг

в DOS означает, что Li_{ads} передает часть электронов в матрицу 4H—SiC и за счет этого энергетические состояния атомов слабо смещаются.

Парциальные вклады PDOS орбиталей как лития, так и углерода формируют плотность состояний атомов в широкозонном $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2 E_g = 3.2 \text{ эB}$). Спектр PDOS $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$ характеризуется пиками гибридизированных атомных орбиталей C2s-2p (sp^1) , где C2s-состояния соответствуют в основном отрицательным энергиям. С2*p*-состояния располагаются вблизи уровня Ферми. В $\alpha - \text{Li}_2\text{C}_2$ спин вверх и спин вниз состояния DOS симметричны и локальный магнитный момент не обнаружен. В полном DOS соединения LiSi запрещенная зона не обнаруживается; по экспериментальным данным LiSi имеет запрещенную зону 0.057 эВ. Отсутствие $E_{\rm g}$ в LiSi связано с s-p-гибридизацией, приводящей к тетраэдрической структуре sp^3 . Энергии $1s^22s^1$ -состояний лития в спектре DOS LiSi незначительные. Присутствие Li в фазе LiSi снижает степень *s-p*-гибридизации.

Вычисленная энтальпия образования бинарных соединений ($A_nB_m = \alpha - \mathrm{SiC}$, $\alpha - \mathrm{Li}_2\mathrm{C}_2$, $\mathrm{Li}_n\mathrm{Si}_m$) системы $\mathrm{Si-C-Li}$ при температуре 298 K, в среднем отличается от экспериментальных данных на $\sim 4\%$. С учетом этого и данных в граничных подсистемах $\mathrm{Si-C}$, $\mathrm{C-Li}$ и $\mathrm{Si-Li}$, построено изотермическое сечение фазовой диаграммы твердого состояния $\mathrm{Si-C-Li}$ которое, позволяет определить области возможных трехфазных равновесий.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Настоящая работа выполнена при частичной поддержке Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики (проект EİF-BGM-4-RFTFl/2017-21/05/l-M-07) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18—57—06001 № Аz а 2018).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Kimoto T., Cooper J.*A. Fundamentals of Silicon Carbide Technology. Growth, Characterization, Devices, and Applications. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 2014. 538 p. ISBN978-1-118-31352-7. https://doi.org/10.1002/9781118313534
- Fan Y., Deng C., Gao Y. et al. // Carbon. 2021. V. 177.
 P. 357.
 https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.02.095
- 3. *Guo J., Dong D., Wang J. et al.* // Adv. Funct. Mater. 2021. 2102546. P. 1. https://doi.org/10.1002/adfm.202102546

- 4. *Huggins R.A.* Advanced Batteries Materials Science Aspects. 1st ed., Science+Business Media, LLC. New York. 2009. 474 p. ISBN-13: 978-0387764238
- Drüe M., Kozlov A., Seyring M. et al. // J. Alloys Compd. 2015. S0925838815309312. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.08.235
- Liang S.-M., Drüe M., Kozlov A. et al. // Ibid. 2017.
 V. 698. P. 743. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.12.271
- 7. *Drüe M., Liang S.-M., Seyring M. et al.* // Int. J. Mater. Res. 2017. V. 108. No 11. 146.111559. P. 933. https://doi.org/10.3139/146.111559
- 8. *He X., Tang A., Li Y., Zhang Y. et al.* // Appl. Surf. Sci. 2021. V. 563. 150269. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150269
- 9. Vasilevskiy K., Wright N.G. Ch. 1. In book: Advancing Silicon Carbide Electronics Technology II. Materials Research Foundations. 2020. V. 69. P. 1. https://doi.org/10.21741/9781644900673-1
- Kong L., Chai C., Song Y. et al. // AIP Advances. 2021.
 V. 11. 045107. P. 1. https://doi.org/10.1063/5.0044672
- 11. *Petersen R.J., Thomas S.A., Anderson K.J. et al.* // J. Phys. Chem. C. 2022. P. 1. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c03948
- 12. *Ruschewitz U., Pöttgen R.* // Z. Anorg. Allg. Chem. 1999. V. 625. No 10. P. 1599. https://doi.org/10.1002/(sici)1521-3749(199910)625:10<1599:: aid-zaac1599>3.0.co;2-j
- Kozlov A., Seyring M., Drüe M., et // J. Mater. Res. 2013. V. 104. No 11. P. 1066. https://doi.org/10.3139/146.110960
- Johanna N., Sumit K., Peter L. et al. // J. Chem. Phys. 2012. V. 137. No 22. 224507. P. 1. https://doi.org/10.1063/1.4770268
- Tian N., Gao Y., Li Y. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2016. V. 5. No 2. P. 644. https://doi.org/10.1002/anie.201509083
- Ali S. // Madridge J. Nanotechnol Nanosci. 2017. V.2. No 1. P. 73. https://doi.org/10.18689/mjnn-1000113
- 17. *Gu M., He Y., Zheng J., Wang C.* // Nano Energy. 2015. S221128551500350X. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2015.08.025
- Guo J., Dong D., Wang J. et al. // Adv. Funct. Mater. 2021. P. 1. https://doi.org/10.1002/adfm.202102546
- Obrovac M.N., Christensen L. // Electrochem. Solid-State Lett. 2004. V. 7. No 5. P. A93. https://doi.org/10.1149/1.1652421
- 20. Wu H., Cui Y. // Nano Today. 2012. V. 7. No 5. P. 414. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2012.08.004
- 21. *Morachevskii A.G., Demidov A.I.* // Rus. J. Appl. Chem. 2015. V. 88. No 4. P. 547. https://doi.org/10.1134/S1070427215040011

- 22. *Wang P., Kozlov A., Thomas D. et al.* // Intermetallics. 2013. V. 42. P. 137. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2013.06.003
- 23. *Kim H., Chou C.-Y., Ekerdt J.G., Hwang G.S.* // J. Phys. Chem. C. 2011. V. 115. P. 2514. https://doi.org/10.1021/jp1083899
- Chiang H.-H., Lu J.-M., Kuo C.-L. // J. Chem. Phys. 2016. V. 144. 034502. P. 1. https://doi.org/10.1063/1.4939716
- 25. *Chiang H.-H., Lu J.-M., Kuo C.-L.* // Ibid. 2017. V. 146. No 6. 064502. P. 1. https://doi.org/10.1063/1.4975764
- Dębski A., Zakulski W., Major Ł. et al. // Thermochim. Acta. 2013. V. 551. P. 53. https://doi.org/10.1016/j.tca.2012.10.015
- 27. *Thomas D., Abdel-Hafiez M., Gruber T.* // J. Chem. Thermodynamics. 2013. V. 64. P. 205. https://doi.org/10.1016/j.jct.2013.05.018
- Dębski A., Gąsior W., Góral A. // Intermetallics. 2012.
 V. 26. P. 157. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2012.04.001
- Thomas D., Zeilinger M., Gruner D. et al. // J. Chem. Thermodynamics. 2015. V. 85. P. 178. https://doi.org/10.1016/j.jct.2015.01.004
- Taubert F., Schwalbe S., Seidel J. et al. // Int. J. Mater. Res. 2017. V. 108. 146.111550. P. 943. https://doi.org/10.3139/146.111550
- 31. *Thomas D., Bette N., Taubert F. et al.* // J. Alloys Compd. 2017. V. 704. 0925–8388. P. 398. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.02.010
- 32. *Taubert F., Thomas D., Hüttl R. et al.* // Ibid. 2022. V. 897. 163147. P. 898. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163147
- 33. *Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Guseinova S.S., Lu-kichev V.F.* // Rus. Microelectronics. 2022. V. 51. No. 2. P. 83. https://doi.org/10.1134/S1063739722010024

- 34. *Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Guseinova S.S., Lu-kichev V.F.* // Phys. Solid State. 2022. V. 64. No. 5. P. 528. https://doi.org/10.21883/0000000000
- 35. *Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M.* // Phys. Rev. Lett. 1996. V. 77. No 18. P. 3865. https://doi.org/10.1103/physrevlett.77.3865
- Asadov S.M., Mustafaeva S.N., Huseinova S.S., Lukichev V.F. // Russ. J. Phys. Chem A, 2024. V. 98. No 1. P. 1. https://doi.org/10.1134/S0036024424010023
- 37. *Asadov M.M., Mammadova S.O., Guseinova S.S. et al.* // Rus. Microelectronics. 2022. V. 51. No 6. P. 413. https://doi.org/10.1134/S1063739722700159
- 38. *Madelung O.* Semiconductors: Data Handbook. 3rd edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New Yor. 2004. 690 p. ISBN 978-3-642-62332-5.
- 39. *He J.*, *Song X.*, *Xu W. et al.* // Mater. Lett. 2013. V. 94. P. 176. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2012.12.045
- 40. *Davydov S. Yu., Posrednik O.V.* // Semicond. 2020. V. 54. Is. 11. P. 1197.
- 41. *Zhang Y.J., Yin Z.-P., Su Y., Wang D.-J.* // Chin. Phys. B. 2018. V. 27. No 4. 047103.
- 42. *Zhao G.L.*, *Bagayoko D.* // New J. Phys. 2000. V. 2. P. 1. http://www.njp.org/
- 43. CRC Handbook of Chemistry and Physics. D.R. Lide. Ed. CRC Press, Boca Raton, FL. 2005. http://www.hbcpnetbase.com
- 44. *Braga M.H.*, *Dębski A.*, *Gąsior W.* // J. Alloys Compd. 2014. V. 616. P. 581. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.06.212
- 45. *Morris A.J.*, *Grey C.P.*, *Pickard C.J.* // arXiv: 1402.6233v1 [cond-mat.mtr-sci] 25 Feb 2014. P. 1.
- 46. *Asadov M.M.*, *Kuli-zade E.S.* // J. Alloys Compd. 2020. V. 842. 155632. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155632